高度研所属学生の藤野貴大君が国際会議 SPIE Photomask Technology 2015 にて「ZEISS Award」を受賞

高度研所属学生の藤野貴大君が 2015/9/29-10/1 にアメリカ・カリフォルニア州・モントレーにて開催された国際会議 SPIE Photomask Technology 2015 にて「ZEISS Award」（http://spie.org/x110981.xml）を受賞しました。SPIE Photomask Technology は半導体原板のフォトマスク開発に携わる企業、要素技術の開発を進める大学や研究所が一同に集まり、成果を発表する世界最大の国際会議です。

藤野君は４月に開催された国際会議 Photomask Japan 2015 にて学生賞を受賞し、今回の会議に Photomask Technology 学生賞の最終審査対象者として招待され口頭講演を行いました。その結果、学生賞ではなく、全発表者を対象とした「ZEISS Award」を受賞しました。また、本賞は今回から新しく始まった賞であり、記念すべき第１回目の受賞者となりました。

受賞した研究はコヒーレント EUV 光を利用した顕微鏡の開発です。光源には従来ニュースバル放射光施設を利用していましたが、顕微鏡の実用化のためレーザー励起の高次高調波を採用しました。今回は光学系の改造により、利用光量を 130 倍に高め、欠陥検出時間を千分の１に短縮できたことが大きな成果です。